



## ДЕФОРМАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ В *n*-Ge ПРИ ГЕЛИЕВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Аветисян С. К., Данагулян С. С., Минасян Г. Р.

Теоретически исследовано распространение гауссовых импульсов различной длительности через *n*-Ge при гелиевых температурах.

В уравнении распространения, кроме однофотонного поглощения, связанного с фотоионизацией примесей и внутризонными переходами, учтено также двухфотонное непрямое поглощение. Показано, что имеет место укорочение импульса. Это связано с насыщением поглощения при высоких мощностях. Показано также, что для импульсов с начальной длительностью, меньшей времени фотоионизации и захвата носителей на примесные центры, не только отсутствует укорочение, но и имеет место увеличение длительности. Проведено сравнение результатов с экспериментальными данными.

В экспериментальной работе [1] исследовалось нелинейное поглощение излучения CO<sub>2</sub>-лазера на длине волн 10.6 мкм в *n*-Ge при низких температурах. Было обнаружено, что при высоких мощностях имеет место насыщение поглощения, приводящее к укорочению лазерного импульса. Уменьшение длительности лазерного импульса в *n*-Ge было обнаружено также при комнатных температурах [2]. Однако следует отметить, что механизмы нелинейности, приводящие к насыщению поглощения и изменению длительности импульса при низких и высоких температурах, различны. Эти различия отражаются как на профиле, так и на длительности выходящего из кристалла лазерного импульса. В данной работе теоретически исследовано распространение гауссовых импульсов различной длительности через *n*-Ge при гелиевых температурах и проведено сравнение результатов с экспериментом [1].

При низких интенсивностях основная нелинейность в *n*-Ge обусловлена фотоионизацией и обратным захватом носителей на примесные центры [1]. С увеличением интенсивности, когда становится заметной концентрация свободных носителей, начинают играть важную роль непрямые двухфотонные переходы из минимума *L* в минимум *Г* зоны проводимости [3]. Два отмеченных механизма нелинейности учтены нами для объяснения обнаруженного в эксперименте [1] укорочения лазерных импульсов. Соответствующее уравнение распространения (в направлении оси *z*) может быть записано следующим образом [3]:

$$\frac{\partial I(z, t)}{\partial z} = -\alpha_1(I)I - \alpha_2(I)I^2, \quad (1)$$

где *I*(*z*, *t*) — интенсивность излучения,  $\alpha_1(I)$  — коэффициент однофотонного поглощения, рассчитанный с учетом захвата носителей на примесные центры [1],  $\alpha_2(I)$  — коэффициент двухфотонного поглощения *L* → *Г*, рассчитанный в случае низких температур [3]:

$$\begin{aligned} \alpha_1(I) &= (N_D - n - N_A)\sigma_1 + (n - n_1)\sigma_2 + n_1\sigma_3, \\ \alpha_2(I) &= \sigma_4(n - n_1). \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь *N<sub>D</sub>* и *N<sub>A</sub>* — концентрации доноров и акцепторов,  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  — сечения фотоионизации и внутризонного поглощения в минимумах *L* и *Г* соответственно,  $\sigma_4$  —

сечение непрямого двухфотонного поглощения  $L \rightarrow \Gamma$ ,  $n_1$  — концентрация электронов в минимуме  $\Gamma$ , появляющихся вследствие двухфотонных переходов,  $(n - n_1)$  — концентрация электронов в минимуме  $L$ . Концентрации  $n$  и  $n_1$  определяются из следующих кинетических уравнений:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = (N_D - n - N_A) \sigma_1 \frac{I(z, t)}{\hbar \Omega} - (n - n_1) (n + N_A) \sigma_5 \langle v \rangle, \quad (3)$$

$$\frac{\partial n_1}{\partial t} = \frac{1}{2\hbar\Omega} (n - n_1) \sigma_4 I^2(z, t),$$

где  $\hbar\Omega$  — энергия кванта излучения,  $\sigma_5$  — сечение захвата электрона примесным центром,  $\langle v \rangle$  — средняя скорость электрона в зоне проводимости.

Форма выходящего из кристалла импульса определена нами численным интегрированием уравнений (1) и (3) для образца  $n$ -Ge длиной 3 см с концентрациями  $N_A = 0$ ,  $N_D = 1.5 \cdot 10^{16}$  см $^{-3}$  в соответствии с экспериментом [1]. Численные значения сечений  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$ ,  $\sigma_4$ ,  $\sigma_5$  приведены в работах [1, 3]. На рис. 1 показаны

формы входящего гауссовского импульса с длительностью 200 нс и выходящего импульса. Следовательно, укорочение импульса составляет 25 %, что находится в согласии с экспериментом [1]. В отличие от случая высоких температур при низких температурах, как это видно из рисунка, помимо заднего фронта деформируется передний фронт импульса. Это связано с тем, что на обоих фронтах импульса имеет место сильная фотоионизация. Как показали расчеты, для импульсов с длительностью, меньшей времени захвата на примесный центр, поглощение на заднем фронте подавлено.

Как показал расчет, при пиковых интенсивностях выше  $I_0 = 10$  МВт/см $^2$

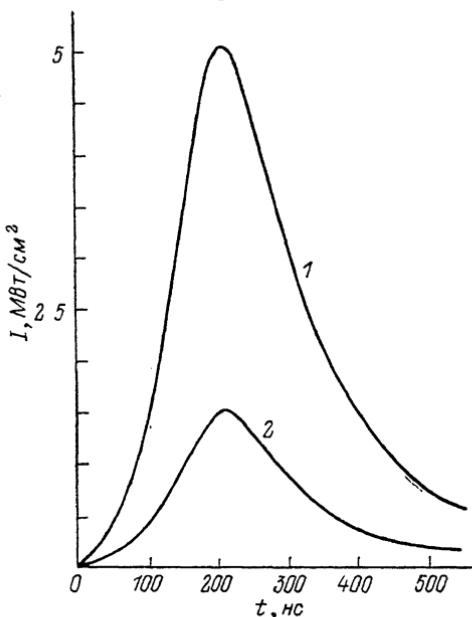


Рис. 1. Формы входящего (1) и выходящего (2) импульсов.

и длительности входящего импульса 200 нс спад среднего коэффициента поглощения  $\bar{\alpha}(E_i)$  от входящей энергии  $E_i$ , обусловленный насыщением поглощения [1, 3], заменяется линейным ростом. Такая немонотонность, связанная с возрастанием роли двухфотонного поглощения, легко может быть обнаружена в эксперименте. Увеличение поглощения при больших мощностях отражается на форме и длительности выходящего из кристалла импульса. На рис. 2 приведены результаты численного расчета относительного изменения длительности трех гауссовых импульсов с одинаковой максимальной пиковой интенсивностью  $I_{0\max} = 15$  МВт/см $^2$  от  $I_0$ . Кривая 1 на рис. 2 соответствует длительности входящего импульса  $\tau_{ax} = 200$  нс. Как видно из рисунка, до пиковой интенсивности 2.7 МВт/см $^2$  импульс монотонно сужается, достигая 75 % от начальной длительности. При дальнейшем увеличении  $I_0$  темп укорочения уменьшается, и при  $I_0 = 11$  МВт/см $^2$  длительности входящего и выходящего импульсов оказываются одинаковыми. Последнее связано с тем, что при пиковых интенсивностях выше 10 МВт/см $^2$  в центральной части импульса имеет место сильное поглощение, обусловленное двухфотонными переходами  $L \rightarrow \Gamma$ . Это приводит к тому, что деформируются не только фронты импульса, но и центральная часть, что отражается на его длительности при выходе из кристалла. Кривые 2 и 3 на рис. 2 соответствуют длительностям входящих импульсов 4 и 0.04 нс. Несмотря на большую разницу в энергиях, как это видно из кривой 2, импульс с начальной длительностью  $\tau_{ax} = 4$  нс деформируется практически аналогично импульсу

$\tau_{\text{вых}} = 200$  нс. Это связано с тем, что длительность входящего импульса ( $\tau_{\text{вх}} = 4$  нс) все еще больше времен фотоионизации  $\tau_1$  и захвата электрона на донорный центр  $\tau_2$  [1], и поэтому при нахождении  $\alpha_1(I)$  и  $\alpha_2(I)$  эффекты нестационарности оказываются несущественными. Качественно другая картина имеет место в случае импульса с длительностью, меньшей  $\tau_1$  и  $\tau_2$  (кривая 3). Как видно из кривой 3, в этом случае не только отсутствует укорочение импульса, но и имеет место увеличение длительности при интенсивностях выше 3 МВт/см<sup>2</sup>. Отсутствие укорочения в рассмотренном случае обусловлено тем, что за время порядка длительности импульса не успевают развиваться процессы фотоионизации и захвата носителей на донорные центры. Увеличение длительности импульса при пиковых мощностях выше 3 МВт/см<sup>2</sup> связано с тем, что, несмотря на малую длительность, в центральной части импульса имеет место заметная фотоионизация, в то время как на фронтах поглощение остается малым.

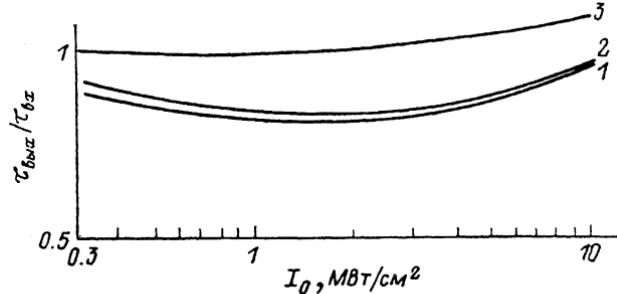


Рис. 2. Зависимость отношения длительностей выходящего и входящего импульсов от пиковой интенсивности.

$\tau_{\text{вх}}$ , нс: 1 — 200, 2 — 4, 3 — 0.04.

В заключение отметим, что численные расчеты проведены также для импульсов с одинаковой входящей энергией  $E_i$ . Как показали расчеты, для рассмотренных выше длительностей картина деформации импульсов на выходе образца практически не меняется.

#### Список литературы

- [1] McManus J. B., People R., Aggarwal R. L., Wolff P. A. // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. N. 7. P. 4748—4752.
- [2] Yuen S. Y., Aggarwal R. L., Lax B. // J. Appl. Phys. 1979. V. 51. N 2. P. 1146—1151.
- [3] Аветисян С. А., Минасян Г. Р., Энфиаджян Р. Л. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 4. С. 766—768.

Ереванский политехнический институт  
им. К. Маркса

Получена 3.01.1990  
Принята к печати 11.04.1990